# Simulazioni atomistiche del processo di cristallizzazione in nanofili di GeTe

#### Edoardo Baldi

Relatore: Prof. Marco Bernasconi

Università di Milano-Bicocca - Dipartimento di Fisica

Sessione di Laurea Magistrale del 23 marzo 2015



# Materiali a cambiamento di fase per memorie ottiche ed elettroniche

Memorie ottiche: *DVD-RW, Blu-ray Disc* 

Memorie elettroniche non volatili: *memorie a cambiamento di fase* (PCM)





Leghe di calcogenuri: GeTe, Ge<sub>2</sub>Sb<sub>2</sub>Te<sub>5</sub> (GST)

Rapida e reversibile transizione tra cristallo e amorfo (~ 50 ns

# Materiali a cambiamento di fase per memorie ottiche ed elettroniche

Memorie ottiche: DVD-RW, Blu-ray

Disc

Memorie elettroniche non volatili: memorie a cambiamento di fase

(PCM)





Leghe di calcogenuri: GeTe, Ge<sub>2</sub>Sb<sub>2</sub>Te<sub>5</sub> (GST)

Rapida e reversibile transizione tra cristallo e amorfo (~ 50 ns)

### Materiali a cambiamento di fase

Due stati della memoria



bit "0" o "1"

Grande differenza nelle proprietà tra le due fasi

Fase cristallina 

metallica



Fase amorfa



isolante

Variazione di resistività di 3 ordini di grandezza

PCM

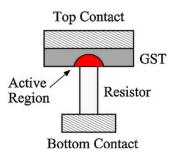
Differenza della riflettività del 30%

memorie ottiche

La transizione è indotta per riscaldamento (impulsi laser/corrente)

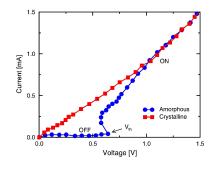
#### Cella PCM

- Regione attiva: piccola porzione del film di materiale a cambiamento di fase che subisce la transizione
- Transizione indotta per effetto Joule



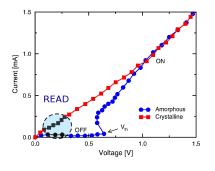
- *Lettura*: eseguita a bassa tensione ( $V < V_{th}$ )
- Processi di set/reset: tensione applicata maggiore del valore V<sub>th</sub>)
  - Reset: elevata infensita di
    corrente e impulso breve
    eristallo -> amorfo

    Ser: bassa infensita e
    inculso nili limeo

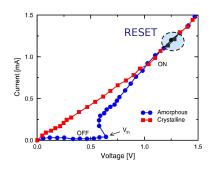


- Lettura: eseguita a bassa tensione ( $V < V_{th}$ )
- Processi di set/reset: tensione applicata maggiore del valore V<sub>th</sub>)

■ Reset: elevata intensità di corrente e impulso breve cristallo → amorfo
 ■ Set: bassa intensità e impulso più lungo



- Lettura: eseguita a bassa tensione ( $V < V_{th}$ )
- Processi di set/reset: tensione applicata maggiore del valore V<sub>th</sub>)
  - Reset: elevata intensità di corrente e impulso breve cristallo → amorfo
  - Set: bassa intensità e impulso più lungo amorfo → cristallo



- Lettura: eseguita a bassa tensione (V < V<sub>th</sub>)
- Processi di set/reset: tensione applicata maggiore del valore V<sub>th</sub>)
  - Reset: elevata intensità di corrente e impulso breve cristallo → amorfo
  - Set: bassa intensità e impulso più lungo amorfo → cristallo

